氏名(本籍地) 伊藤啓太(長野県) 学 博士(工学) 位 の種 類 学 位 博 甲 第 6823 号 記 番 学位授与年月 平成26年3月25日 日 学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当 審 杳 研 究 数理物質科学研究科 学位論文題目 逆ペロブスカイト型遷移金属強磁性窒化物の磁気特性 筑波大学教授 博士(工学) 末益 崇 主 査 筑波大学教授 副 査 工学博士 喜多英治 筑波大学教授 理学博士 黒田眞司 副 査 副 査 東北大学准教授 博士(工学) 角田匡清 副 杳 產業技術総合研究所 工学博士 安藤功兒

論 文 の 要 旨

近年、電子の電荷とスピンの双方を利用して新機能デバイスの創出を目指す、スピントロニク スと呼ばれる研究分野が注目を集めている。すでに、トンネル磁気抵抗効果を利用したハードデ ィスクの読み取りヘッド、次世代ユニバーサル不揮発性メモリの 1 つである MRAM が製品化され ており、強磁性体から半導体へのスピン注入の研究も盛んに進められている。高性能なスピント ロニクスデバイスの実現には、スピン分極率が大きな強磁性体材料が求められる。実験、理論計 算の双方からの高スピン分極率材料の探索が進められており、逆ペロブスカイト型遷移金属強磁 性窒化物の Fe₄N、Co₄N、Mn₄N およびそれらの混晶系が、新たなスピントロニクス応用材料とし て注目されている。Fe4N は古くから知られる強磁性材料であるが、最近になりフェルミ準位での 状態密度のスピン分極率(P_D)が負であり、また、電気伝導度のスピン分極率(P_D)が-1.0と大きいこ と、Fe₄N の Fe 原子を Co 原子で置き換えた Co₄N では、第一原理計算の結果からフェルミ準位に おける P_D が-0.88 と報告されており、 Fe_4N の理論予想値の-0.67 を上回る。また、ペロブスカイ ト格子の角位置(I サイト)に Fe 原子、面心位置(II サイト)に Co 原子が入った Co $_3$ FeN のフェルミ準 位における P_D についても、 Fe_4N の理論予想を上回る-0.75 との理論計算結果が報告されている。 Fe_4N の Fe 原子を Mn 原子で置き換えた Mn_4N では、MgO(001)基板上にスパッタリング法で作製 された薄膜において、磁歪の逆効果による垂直磁気異方性の発現が報告されている。さらに、ス ピン分極率が大きい Fe₄N や Co₄N との混晶を作製することで、スピン分極率が大きく、垂直磁気 異方性をもつ新材料の実現が期待される。しかし、Co₄N と Fe₄N の混晶である(Co.Fe)₄N や、Co₄N と Mn₄N の混晶である(Mn,Co)₄N は、エピタキシャル成長の報告例が無く、そのため磁気特性が明 らかになっていない。本論文では、これらの薄膜を分子線エピタキシー法(MBE法)により形成し 磁気特性を明らかにすることを目的とした。

MBE 法により、SrTiO₃(STO)(001)基板上に基板温度 450 °C で固体 Fe, Co および高周波プラズマ 窒素(N₂流量 1sccm)を同時供給し、Co/Fe 比が異なる Co_xFe_{4-x}N(25 nm)薄膜のエピタキシャル成長 を試みた。Fe₄N、Co₄N と STO(001)基板の格子不整合率は、それぞれ-2.8%、-4.3%である。試料の結晶性を反射高速電子線回折(RHEED)、X 線回折(XRD)測定により評価した。Co/Fe 比はラザフォード後方散乱法とエネルギー分散型 X 線分光法により測定した。その結果、Co 組成比 x を変えた Co_xFe_{4-x}N 薄膜の ω -2 θ XRD パターンから、いずれの試料からも Co_xFe_{4-x}N(001), (002), (004)の回 折ピークが得られ、Co_xFe_{4-x}N 薄膜(0.4 \leq x \leq 2.9)のエピタキシャル成長に成功した。Co の比率が増えるにつれて回折ピークが現れる角度が高角度側にシフトし、格子定数が小さくなった。また、

続いて、MBE 法により STO(001)、MgO(001)基板上に基板温度 450 °C で固体 Mn, Co および高周波プラズマ窒素(N_2 流量 1sccm)を同時供給し、Mn/Co 比が異なる $Co_xMn_{4-x}N(\sim 10 \text{ nm})$ 薄膜のエピタキシャル成長を試みた。RHEED パターンよりストリークが得られ、また、X 線回折測定より(001)配向の回折ピークのみが観察されたことから、 $Co_xMn_{4-x}N(0< x< 1.3)$ のエピタキシャル成長に成功したといえる。続いて、膜厚を 10nm から 50nm まで変えて Mn_4N 薄膜を作製し、膜中の格子歪みを測定したところ、いずれの試料も膜厚にかかわらず、面内に約 1%の引っ張り歪を受けていた。 Mn_4N 薄膜の磁化特性を室温で測定したところ、外部磁場が面直方向の際に保持力が大きくなり、ヒステリシス曲線が開いたため、垂直磁気異方性が発現したといえる。異方性エネルギーは約 2.2×10^6 erg/cc であった。

審査の要旨

〔批評〕

Fe4N, Co4N, Mn4N およびそれらの混晶は、スピントロニクス材料として期待されている。本論文では固体 Fe, Co, Mn および高周波プラズマ窒素を同時供給する MBE 法により、Co4N、(Co,Fe)4N, (Co,Mn)4N 膜のエピタキシャル成長に初めて成功し、これらの磁気特性を調べた。その結果、スピン分解光電子分光測定により Fe4N はフェルミ準位で負の負ピン分極率をもつことを明らかにした。さらに、(Co,Fe)4N においては Fe および Co 原子の磁気モーメントを XMCD 測定により算出し、Coと Fe 原子が I および II サイトの両方に存在することを XMCD 測定およびメスバウアー測定により明らかにした。さらに、Mn4N の垂直磁気異方性が面内引っ張り歪によることを明らかにし、異方性性エネルギーの値を得た。以上の結果から、Fe4N, Co4N, Mn4N およびそれらの混晶は、新しいスピントロニクス材料として、今後の実用化が大いに期待されるといえる。

[最終試験結果]

平成26年2月20日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、 著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によって、合格と判定された。

[結論]

上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。